

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 5 部門第 1 区分

【発行日】平成27年12月17日 (2015.12.17)

【公表番号】特表2012-528974(P2012-528974A)

【公表日】平成24年11月15日 (2012.11.15)

【年通号数】公開・登録公報2012-048

【出願番号】特願2012-513497(P2012-513497)

【国際特許分類】

F 0 1 N 3/023 (2006.01)

F 0 1 N 3/025 (2006.01)

F 0 1 N 3/029 (2006.01)

F 0 1 N 3/36 (2006.01)

F 0 1 N 3/24 (2006.01)

B 0 1 D 53/94 (2006.01)

【 F I 】

F 0 1 N 3/02 3 2 1 B

F 0 1 N 3/36 Z A B M

F 0 1 N 3/24 E

F 0 1 N 3/24 L

B 0 1 D 53/36 1 0 4 Z

B 0 1 D 53/36 1 0 4 B

【誤訳訂正書】

【提出日】平成27年10月26日 (2015.10.26)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

内燃機関用排ガス後処理システムであって、

内燃機関の工程排ガスが通る排ガス管に炭化水素を導入するための装置と、当該装置は、前記炭化水素を少なくとも部分的に蒸発させ、かつクラック反応によって、及び / 又は部分酸化によって化学変化させるための装置であり、

工程排ガスによって導入箇所の下流へと貫流される、一部が蒸発し、クラック反応によって及び / 又は部分酸化によって化学変化した、前記導入された炭化水素を酸化することによって工程排ガス温度を高める処理装置と、  
を有する前記排ガス後処理システムにおいて、

少なくとも部分的に蒸発させるため、またクラック反応により、及び / 又は部分酸化により炭化水素に化学変化を起こすための前記装置が、燃料及び空気用の供給装置を備えるバーナー ( 2 ) と、燃焼チャンバ ( 3 ) と、炭化水素用注入装置 ( 5 ) を備える排ガス導管 ( 4 ) とを有する配置構成であり、当該導管 ( 4 ) は、排ガス管 ( 6 ) への導入箇所で開口しており、

工程排ガス温度を高める前記処理装置は、触媒により被覆された部材を有し、

ここで白金の割合が、少なくとも前記部材の触媒被覆の部分領域で、前記被覆の当該部分領域にある触媒作用を有する全物質の全質量の 50 % 未満であり、

ここで触媒により被覆された前記部材は、触媒基材又は粒子フィルターであり、当該触媒基材又は粒子フィルターは、それぞれ一様に、又は領域により異なって被覆されてお

り、

前記処理装置の前記部材にある触媒被覆の部分領域が、工程排ガス温度を高める処理装置の部材における触媒被覆の全質量の少なくとも20%であり、かつ、前記部分領域の触媒被覆のパラジウム割合が、前記処理装置の部分領域にある全貴金属の全質量の少なくとも75%である

ことを特徴とする、前記排ガス後処理システム。

【請求項2】

前記部分領域の触媒被覆が、全貴金属質量で部材体積若しくは基材体積に対して0.1～10g/Lの範囲の貴金属を含有することを特徴とする、請求項1に記載の排ガス後処理システム。

【請求項3】

貴金属の割合が、前記処理装置の部分領域にある触媒作用を有する全物質の全質量に対して、10%超であることを特徴とする、請求項2に記載の排ガス後処理システム。

【請求項4】

前記部分領域にある触媒被覆の白金含分が、前記処理装置の部分領域にある触媒作用を有する全物質の全質量の1%未満であることを特徴とする、請求項2又は3に記載の排ガス後処理システム。

【請求項5】

前記部分領域が、工程排ガス温度を高める触媒被覆部材の全部、又は工程排ガス温度を高める1つの触媒被覆部材の一部、若しくは工程排ガス温度を高める複数の触媒被覆部材の一部を含むことを特徴とする、請求項1から4までのいずれか1項に記載の排ガス後処理システム。

【請求項6】

前記部分領域が、流れ方向で、工程排ガス温度を高める触媒被覆部材の領域的な被覆の前方部であることを特徴とする、請求項1から4までのいずれか1項に記載の排ガス後処理システム。

【請求項7】

前記排ガス導管(4)中にある前記注入装置(5)の開口部(11)が、噴霧ノズルを有することを特徴とする、請求項1から6までのいずれか1項に記載の排ガス後処理システム。

【請求項8】

前記注入装置(5)の開口部(11)の領域にある前記排ガス導管(4)に、ベンチュリ装置(12a)が配置されていることを特徴とする、請求項1から7までのいずれか1項に記載の排ガス後処理システム。

【請求項9】

前記バーナー(2)、前記排ガス導管(4)、及び前記注入装置(5)が、ジャケット(1)内に組み込まれており、当該ジャケット(1)が排ガス管(6)に適合されていることを特徴とする、請求項1から8までのいずれか1項に記載の排ガス後処理システム。

【請求項10】

前記排ガス導管(4)が、排出部(7)を有し、前記排ガス導管(4)が、前記排ガス管(6)内に延伸していることを特徴とする、請求項1から9までのいずれか1項に記載の排ガス後処理システム。

【請求項11】

前記排ガス導管(4)が、前記排ガス管(6)内へと同心状に通じており、これにより前記排ガス導管(4)からの排出部(7)が、工程排ガス流の流れ方向に配置されていることを特徴とする、請求項10に記載の排ガス後処理システム。

【請求項12】

排出部(7)の領域にクエンチ装置(13)、及び/又はベンチュリ装置が存在していることを特徴とする、請求項10又は11に記載の排ガス後処理システム。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0055

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0055】

触媒C（本発明によるもの）：

コーディエライト基材上にPt：Pdを1：4（質量割合）で40 g / f t<sup>3</sup>有するDOC、寸法はD9.5"×L4.5"、セル密度300 c p s i、壁厚は5ミル。この触媒は、アルミノシリケート（BET比表面積150 m<sup>2</sup> / g、SiO<sub>2</sub>は5%）を硝酸パラジウム溶液及び硝酸白金溶液で含浸し、この含浸した酸化物を130 g / Lの負荷量で基材に施与し、引き続き乾燥及び温度処理して製造した。この触媒は、それから16時間、700 で、炉内で空気中でエージングした。

【誤訳訂正3】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0056

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0056】

触媒D（本発明によるもの）：

コーディエライト基材上にPt：Pdを1：2（質量割合）で30 g / f t<sup>3</sup>有するDOC、寸法はD9.5"×L4.5"、セル密度300 c p s i、壁厚は5ミル。この触媒は、アルミノシリケート（BET比表面積150 m<sup>2</sup> / g、SiO<sub>2</sub>は5%）を硝酸パラジウム溶液及び硝酸白金溶液で含浸し、この含浸した酸化物を130 g / Lの負荷量で基材に施与し、引き続き乾燥及び温度処理して製造した。この触媒は、それから16時間、700 で、炉内で空気中でエージングした。

【誤訳訂正4】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0057

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0057】

触媒E（本発明によらないもの）：

コーディエライト基材上にPt：Pdを2：1（質量割合）で30 g / f t<sup>3</sup>有するDOC、寸法はD9.5"×L4.5"、セル密度300 c p s i、壁厚は5ミル。この触媒は、アルミノシリケート（BET比表面積150 m<sup>2</sup> / g、SiO<sub>2</sub>は5%）を硝酸パラジウム溶液及び硝酸白金溶液で含浸し、この含浸した酸化物を130 g / Lの負荷量で基材に施与し、引き続き乾燥及び温度処理して製造した。この触媒は、それから16時間、700 で、炉内で空気中でエージングした。